

МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА РЕАКТИВНО-ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ



МВУ ТМ ПЛАЗМА 01

Назначение:

Травление тонких диэлектрических и металлических слоёв, а также полупроводниковых материалов методом реактивно-ионного травления.

Особенности:

- Рабочая поверхность стола-ВЧ электрода \varnothing 180 мм;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ электрода-подложкодержателя в диапазоне 30-200 Вт;
- Рабочие газы: Ar, SF₆, O₂, CF₄;
- Форвакуумная система откачки;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 3 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 2,5 м².

